

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【公表番号】特表2005-507088(P2005-507088A)

【公表日】平成17年3月10日(2005.3.10)

【年通号数】公開・登録公報2005-010

【出願番号】特願2003-504167(P2003-504167)

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/32

B 41 N 3/08

G 03 F 7/00

【F I】

G 03 F 7/32

B 41 N 3/08 102

G 03 F 7/00 503

【手続補正書】

【提出日】平成16年2月23日(2004.2.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

画像形成方法であって、

(a)親水性支持体上に画像化可能層を有する画像化可能エレメントを画像化し、画像化可能層内に露光領域および非露光領域を含む画像化されたエレメントを形成するステップと、

(b)画像化されたエレメントを水性アルカリ現像-ガム溶液と接触させ、画像化可能層の露光領域および非露光領域の一方を除去することにより、画像化されたエレメントの現像とガム液処理を同時に行うステップとを含み、

水性アルカリ現像-ガム溶液が、以下の構造：

$R^1 (CH_2OH)_n R^2$

[式中、nは4~7であり、

(i) R^1 は水素、アリール基、または CH_2OH であり、かつ R^2 は水素、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、 CH_2OR^3 (式中、 R^3 は水素、もしくは1~4個の炭素原子を有するアルキル基である)、 $CH_2N(R^4R^5)$ (式中、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立に水素、もしくは1~4個の炭素原子を有するアルキル基である)、または CO_2H であるか、あるいは

(ii) R^1 および R^2 が一緒にになって炭素-炭素単結合を形成する]

を有する1種または複数の水溶性ポリヒドロキシ化合物を含み、

水性アルカリ現像-ガム溶液が約10.0~約14のpHを有し、

1種または複数のポリヒドロキシ化合物が水性アルカリ現像-ガム溶液の約10重量%~約30重量%を構成する

方法。

【請求項2】

(i) 画像化可能層がノボラック樹脂を含み、(ii) 基板がアルミニウムまたはアルミニウム合金を含み、(iii) 水性アルカリ溶液のpHが約12~約13.5であり、(iv) 露光領域が除去され、かつ(v)ステップ(b)の後にすすぎステップおよび別のガム液処理ステップのいずれ

も含まない、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

請求項1または2に記載の方法により生成された画像。